(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-139067

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl.4

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/304

304

341 Z

C09J 7/02 H01L 21/301

H01L 21/78

M

審査酬求 未酬求 請求項の数3 FD (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出版日

特願平6-298798

平成6年(1994)11月7日

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下建積1丁目1番2号

(72)発明者 近田 縁

大阪府淡木市下植積1丁目1番2号 日東

電工株式会社内

(72)発明者 三木 和帝

大阪府炭木市下穂積1丁目1番2号 日東

軍工株式会社内

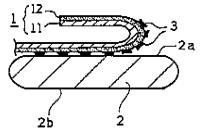
(74)代理人 弁理士 袮▲ぎ▼元 邦央

(54) 【発明の名称】 半導体ウエハに付着した異物の除去用粘着テープと除去方法

(57)【要約】

【目的】 粘着テ─プを用いたドライ洗浄方式において、作業性やウエハ損傷、糊残りなどの問題を生じずに、ウエハよの異物を効率的に除去する。

【構成】 異物除去用粘着テープ1として、支持フィルム11上に、ベースポリマーおよび重合性化合物を含有する、活性エネルギー源により硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有する粘着剤層12を設けてなり、上記の重合性化合物が分子中に2個以上の炭紫ー炭素二重結合を有する25℃での粘度が1,000~30.00センチポイズの重合性モノマーないしオリゴマーからなるものを使用し、この粘着テープ1を半導体ウエハ2の表面2aおよび/または裏面2bに貼り付け、活性エネルギー源の供給後剥離操作して、半導体ウエハ2の装面2aおよび/または裏面2bに付着する異物3を粘着剤層12面に吸着させて半導体ウエハ2から除去する。



2:シリコンウエハ

2 4: ウエハ表面

2 b:ウエハ要面

3:異物

(2)

特開平8-139067

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持フイルム上に、ベースポリマーおよび重合性化合物を含有する、活性エネルギー源により硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有する粘着剤層を設けてなり、上記の重合性化合物が分子中に2個以上の炭素ー炭素二重結合を有する25℃での粘度が1,000~30,000センチポイズの重合性モノマーないしオリゴマーからなることを特徴とする半導体ウエハに付着した異物の除去用粘着テープ。

1

【請求項2】 粘着剤層の引張弾性率(試験法JIS K 71 10 27に準ずる)が、活性エネルギー源の供給前で200Kg/cm² 以下、供給後で500Kg/cm² 以上である請求項1に記載の半導体ウエハに付着した異物の除去用粘着テープ。

【請求項3】 半導体ウエハの表面および/または裏面に、請求項1または2に記載の粘着テープを貼り付け、活性エネルギー源の供給後この粘着テープを剥離操作することにより、半導体ウエハの表面および/または裏面に付着する異物を粘着剤層面に吸着させて半導体ウエハから除去することを特徴とする半導体ウエハに付着した 20 異物の除去方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造プロセスに おける洗浄工程に適用される、半導体ウエハに付着した 異物の除去用粘着テープと除去方法に関する。

[0002]

【従来の技術】LSIの商密度化、高集積化、また回路の多様化が進むにつれて、半導体ウエハに存在する塵埃、金属不純物などの異物(パーテイクル)が製品の歩 30 留り、製品の信頼性に大きく影響するようになつてきた。たとえば、半導体ウエハの表面(回路パターン形成面)に存在する異物は、回路形成時に回路の断線やショートの原因となる。また、半導体ウエハの裏面(回路パターン面の反対面)に存在する異物は、回路形成時の露光工程で焦点を狂わす原因となり、また隣接するウエハの表面に転写して回路の断線やショートの原因となる。

【0003】このため、LSIの製造工程では、製造工程内の清浄度のレベルアツプ、ウエハ洗浄技術のレベルアツプに努めており、さまざまな清浄化技術が提案され、実施されてきた。とくに、洗浄工程は全工程の約30%を占めており、歩留りや信頼性アツブのキーポイントである。しかし、最近のLSIの高密度化、高集積化に伴い、従来のウエハ洗浄方法の問題が顕在化してきた。

【0004】ウエハ洗浄方法には、ウエツト洗浄(超純 粘着力が低下して、剥離操作が容易となり水、薬液などによる)と、ドライ洗浄(UVオゾン、O ウエハの損傷や糊残りによる汚染の問題も、プラズマなど)があり、一般にはウエツト洗浄がその 結局、半導体ウエハに付着した異物を上記、汎用性、経済性のバランスのよさから頻繁に適用され 生じることなく高い除去率で容易に吸着的る。ウエツト洗浄の問題点は、洗浄によりウエハから除 50 を見い出し、本発明を完成するに至つた。

去された異物のウエハへの再付着であり、とくにウエハ 裏面に付着している異物は著しい汚染源となる。また、 ウエット洗浄は乾燥工程を必要とするため、乾燥工程で のウエハ汚染の問題が同様に存在する。

【0006】別の試みとして、特開昭48-35771 号公報、特開昭53-92665号公報、特開平1-1 35574号公報などには、粘着テープを用い、半導体 ウエハの表面に付着した異物を上記テープの粘着剤層面 に吸着させて除去する方法が提案されている。この方法 は、一種のドライ洗浄といえるので、ウエツト洗浄にお ける異物の再付着の問題や乾燥工程での汚染の問題を回 避することができ、しかもUVオゾン、O2 プラズマな どの他のドライ洗浄に比べ、異物の除去能力をより高め ちれるものと期待されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記提案の方法は、粘着テープとして、塑性変形しやすい高粘岩力のものを用いると、粘着テープの剥離操作にあたつて、作業性やウエハ損傷の問題、さらには糊残りによるウエハ表面の汚染の問題があり、一方これらの問題を回避するため、硬くて低粘着力の粘着テープを用いると、半導体ウエハに付着した異物を粘着剤層面に十分に吸着させにくい難点があつた。

【0008】本発明は、このような事情に鑑み、ウエツト洗浄方式に比べて有用な粘着テープを用いたドライ洗浄方式において、特定の粘着テープを用いることによつて、その刺離操作に際し、作業性やウエハ損傷の問題、さらには糊残りによるウエハ表面の汚染の問題をきたすことなく、半導体ウエハに付着した異物を高い除去率で除去することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的に対して、鋭意検討した結果、粘着テープとして、活性エネルギー源の供給により硬化するタイプのもので、かつ粘着剤層中に上記硬化に関与する特定の重合性化合物を含ませたものを用いることにより、半導体ウエハへの貼り付け操作時には、ウエハ上の付着異物を粘着剤層面に良好に吸着保持させることができ、剥離操作時には、活性エネルギー源を供給して硬化処理すると、その粘着力が低下して、剥離操作が容易となり、また半導体ウエハの損傷や糊残りによる汚染の問題も少なくなり、結局、半導体ウエハに付着した異物を上記の如き問題を生じることなく高い除去率で容易に吸着除去できることを見い出し、大器明を完成するに至った

(3)

特開平8-139067

4

【0010】すなわち、本発明は、第一に、上記特定の 粘着テープとして、支持フイルム上に、ベースポリマー および重合性化合物を含有する、活性エネルギー源によ り硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有する粘 着剤層を設けてなり、上記の重合性化合物が分子中に2 個以上の炭素一炭素二重結合を有する25℃での粘度が 1,000~30,000センチポイズの重合性モノマーないしオリゴマーからなることを特徴とする半導体ウ エハに付着した異物の除去用粘着テープを提供するもの である。

【0011】また、第二に、半導体ウェハの表面および /または裏面に、上記特定の粘着テープを貼り付け、活 性エネルギー源の供給後この粘着テープを剥離操作する ことにより、半導体ウエハの表面および/または裏面に 付着する異物を粘着剤層面に吸着させて半導体ウエハか ら除去することを特徴とする半導体ウエハに付着した異 物の除去方法を提供するものである。

[0012]

【発明の構成・作用】図1は、本発明の景物除去用粘岩 テープの一例を示したものである。1は粘着テープで、 支持フイルム11上に粘着剤図12を設け、この上にセ パレータ13を重ね合わせた構成となつている。

【0013】支持フイルム11は、活性エネルギー源を十分に透過させる性質を行しているものであればよく、たとえば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、エチレンー酢酸ビニル共取合体、エチレンーエチルアクリレート共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンープロピレン共重合体などのプラスチツクからなる原さが通常10~1,000μmのフイルムである。

【0014】粘着剤層12は、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フツ素樹脂、ゴム(天然ゴム、合成ゴム)などの各種のポリマーをベースポリマーとし、これに重合性化合物と要すれば重合開始剤を含ませてなる、常態下で粘着力、つまり感圧接着性を有するとともに、活性エネルギー源の供給により硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有するものである。なお、上記のベースポリマーがその分子中に炭素一炭素二重結合を有するものであつてもよい。また、上記の活性エネルギー源は、たとえば、紫外線、赤外線(熱)、電子線、エツクス線など40に代表される電磁波、超音波などに代表される弾性波のことである。

【0015】本発明では、このような粘着剤配12において、重合性化合物として、とくに分子中に2個以上、好ましくは3~6個の炭素一炭素二重結合を有する、25℃での粘度が1,000~30,000センチポイズ、好ましくは1,500~15,000センチポイズの範囲にある重合性モノマーないしオリゴマーを用いることをひとつの特徴としている。このような特定粘度の重合性モノマーないしオリゴマーを用いることにより、

異物の吸着保持性、活性エネルギー源による硬化性、剥離操作時の作業性や糊残り防止などに好結果が得られて、ウエハ上の異物を高い除去率で除去することが可能となる。

【0016】これに対し、重合性モノマーないしオリゴマーの25℃での粘度が1,000センチポイズ未満となると、粘着剤層の活性エネルギー源供給前の凝集力が低すぎて、支持フイルムに対する投鑑力が得られず、粘着テープとしての基本的な性能に欠けたものとなり、活性エネルギー源供給後に剥離操作しようとしても粘着剤層が簡単に破壊して著しい刺残りを生じる。また、上記粘度が30,000センチポイズを超えるようになると、活性エネルギー源の供給による硬化性が十分でなく、ウエハ上の異物の除去率が低下しやすい。

【0017】本発明に用いられる重合性モノマーないしオリゴマーの種類としては、たとえば、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジベンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート、ジベンタエリスリトールへキサアクリレート、1、4ーブタンジオールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、市販のオリゴエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレートなどが挙げられる。

【0018】これらの重合性モノマ―ないしオリゴマ―は、1種であつても、2種以上を併用してもよい。2種以上を併用するときは、混合物の粘度が前記範囲に入るようにすればよい。使用型は、ベースポリマ―100重量部に対し、10~1,000重量部、好ましくは80~200重量部である。

【0019】 重合開始剤は、活性エネルギー源の供給によりラジカルを発生しうるものであり、活性エネルギー源の種類に応じて、必要より選択使用される。たとえば、イソプロピルベンソインエーテル、イソブチルベンソインエーテル、ベンソフエノン、クロロチオキサントン、ドデシルチオキサントン、ジメチルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、アセトフエノンジエチルケタール、ベンジルジメチルケタール、αーヒドロキシシクロヘキシルフエニルケトン、2ーヒドロキシメチルフエニルプロパン、または過酸化ベンゾイル、アゾビスイソブチロニトリルなどが用いられる。

【0020】これらの重合開始剤は、1種であつても、2種以上を併用してもよい。使用量は、モノマーないしオリゴマー100重量部に対し、0.1~20重量部の範囲とするのが好ましい。なお、この重合開始剤とともに、トリエチルアミン、テトラエチルペンタアミン、ジメチルアミノエタノールなどのアミン化合物を重合促進剤として併用してもよい。

【0021】このような配合組成からなる粘着剤層12 50 は、上記のベースポリマーおよび重合性モノマーないし (4)

特別平8-139067

オリゴマ―と必要により重合開始剤を含む粘着剤組成物 を、支持フィルム11上に塗着したのち、加熱などによ り架橋処理することにより、また離型紙上に上記と同じ 方法で形成した粘着剤層を支持フイルム11上に贴着す ることにより、形成することができる。粘着剤層12の 厚さとしては、適宜に決定してよいが、通常は5~10 $0 \mu m e t n t k n$

【0022】なお、上記の架橋処理は、必要により施さ れるものであるが、たとえば、アクリル樹脂系の粘着剤 では、ベースポリマーとして分子内に架橋性官能基を有 10 持する。 するアクリル樹脂を用い、この官能基と反応する官能基 を持つた多官能性化合物、たとえばポリイソシアネート 化合物、ポリエポキシ化合物などからなる架橋剤を、粘 着剤組成物中にあらかじめ配合しておけばよい。

【0023】このように形成される粘着剤層12は、引 張弾性率(試験法JIS K 7127に準ずる、以下同じ)が、 活性エネルギー源の供給前で200kg/cm²以下、好ま しくは1~100Kg/cm²、供給後で500Kg/cm²以 上、好ましくは1,000~3,000Kg/cm゙ に設定 されているのがよい。このように設定したときに、ウエ 20 ハ上の異物をより高い除去率で除去することができる。

【0024】粘着剤層の引張弾性率を上記のように設定 するには、用いるべ─スポリマ**─**および重合性化合物の 粒類や量などとともに、架橋剤の添加量や架橋の程度を 適宜調整するなどして行えばよく、その際、重合性化合 物として前記した特定粘度の重合性モノマーないしオリ ゴマーを用いていることにより、上記設定が非常に容易 となる。これに対して、重合性モノマーないしオリゴマ 一の粘度が前記範囲を逸脱するようになると、上記設定 が難しくなり、これに伴つて半導体ウエハ上の異物の除 30 去率が低下しやすい。

【0025】また、この粘着剤層12は、JIS 2-0237に準じて測定されるシリコンウエハに対する1 80度引き剝がし粘着力(常温、剥離速度300mm/ 分)が、通常500g以上/20mm幅、好ましくは70 0~2,000g/20mm幅である。また、活性エネル ギー源を供給して硬化させたのちの上記180度引き剥 がし粘着力(常温、剥離速度300㎜/分)が、通常5 00g以下/20mm幅、好ましくは1~100g/20 mm幅である。

【0026】セパレ─タ13は、粘着テ─プ1の保管時 や流通時などでの汚染防止の点から、半導体ウエハに貼 り付けるまでの間、粘着剂層12の表面を保護するため のもので、上記貼り付け使用時に剥離除去される。この セパレータ13は、通常、紙(無塵紙)、プラスチツク フイルム、金属箔などからなる柔軟な薄葉体で、必要に より剥離剤で表面処理して離型性を付与したものが用い られる。

【0027】本発明においては、上記構成の粘着テープ を用いて、半導体ウエハに付着した異物を除去する。こ 50 【0033】実施例1

の方法は、まず、図2に示すように、半導体ウエハ2の 表面2aおよび/または裏面2bの金面に粘着テープ1 を貼り付ける。これは、たとえば、ハンドローラにより 押圧したのち、数分程度放置するといった方法で行えば よい。ここで、粘着剤圏12は、特定粘度の重合性モノ マーないしオリゴマーを含んで、その引張弾性率が前記 **値となるように設定されているため、ハンドローラによ** る押圧で適度に塑性変形して、ウエハ2上の異物3に十 分に馴染ませることができ、この異物3を良好に吸着保

【0028】このように貼り付けたのち、図2に示すよ うに、粘着テープ1の端部より引き剥がす、剥離操作を 施すが、この剥離操作に先立つて、このテープ1の支持。 フイルム11側から紫外線などの活性エネルギ―源を供 給する。これにより、粘着剤層12は硬化し、分子構造 が三次元網状化する結果、前記高い引張弾性率を示して 硬くてかつ低い粘着力を呈するものとなる。この状態 で、上記の剥離操作を施すと、剥離が非常にスムースに 行え、ウエハ2表面の損傷や糊残りによる汚染をほとん どきたさない。しかも、上記硬化によりウエハ2上の異 物が粘着剤属12面に強く確実に吸着されることにな る。

【0029】この方法により、半導体ウエハ2上の異物 を、従来のドライ洗浄はもちろんのこと、ウエツト洗浄 や既提案の粘着テープを用いる方法に比べても、高い除 虫率で吸消除去することができ、とくに0.2μm以上 の大きさの異物を80%以上除去できるほどの高い除去 率が得られる。

【0030】このようにして半導体ウエハ上の異物を高 い除去率で洗浄除去すると、回路形成時の回路の断線や ショート、露光不良発生が低減し、最終的に作製される 平導体デバイスの歩留りや信頼性が大幅に向上する。ま た、地球環境保全の立場からみて、従来のウエツト洗浄 やドライ洗浄のような純水、薬品、空気、電力などを大 量に消費する沈浄方式を、上記本発明の方式に置き換え ることで、地球環境保全に大きく寄与させることもでき

[0031]

【発明の効果】本発明の異物除去用粘着テ─プとその除 去方法によれば、半導体ウエハに付着した異物を高い除 去率で容易に除去でき、またその際に半導体ウエハの損 傷や糊残りによる汚染といつた問題をきたすことがな く、半導体デバイスの歩留りや信頼性の向上に大きく寄 与させることができる。また、従来の他の洗浄方式など に比べて、地球環境保全の面での寄与効果も得られる。

[0032]

【実施例】つぎに、本発明の実施例を記載して、より具 体的に説明する。なお以下、部とあるのは重量部を意味 するものとする。

特開平8-139067

アクリル酸 n ープチル80部とアクリロニトリル15部 とアクリル酸5部を、酢酸エチル中で常法により共重合 させることにより、数平均分子量が80万のアクリル系 共重合体を得た。このアクリル系共重合体100部に、 ポリイソシアネート化合物からなる架橋剤3部、重合性 オリゴマーとして粘度が14,000センチポイズ(2 5℃) のジペンタエリスリト-ルモノヒドロキシベンタ アクリレート120部、光重合開始剤としてαーヒドロ キシシクロヘキシルフエニルケトン5部を加えて、アク リル系粘着剤の溶液を調製した。

【0034】厚さ50μmのポリエステル支持フイルム のコロナ処理面に、上記のアクリル系粘着剤の溶液を塗 布し、120℃で5分間加熱架橋処理して、厚さ20 μ mの粘着剤層を有する粘着テープを作製した。シリコン ウエハ (ミラ一面) に対する粘着力は、JIS Z-0 237に準じて測定される180度引き剝がし粘着力。 (常温、剝離速度300mm/分)で1,230g/20 mu幅であった。また、粘着テープの背面側、つまり支持 フイルム面側から、活性エネルギー源として、紫外線 (波長365nm、1,000mJ/cm²) を照射し、 同様に粘着力を測定したところ、12g/20m幅であ つた。

【0035】また、厚さ50μmの雕型処理を施したポ リエステルフイルムの処理面に、上記と同じアクリル系 粘着剤の溶液を塗布し、120℃で3分間加熱架橋処理 して厚さ20μmの粘着剤屑を形成した。これをダンベ ル型に加工し、剥離処理を施したポリエステルフイルム と粘着剤層とを分離して、JIS K 7127に準じて、粘着剤 層のみの引張弾性率を測定したところ、75 kg/cm[®]で あつた。また、この粘溶剤層に、紫外線(波長365m m、1,000mJ/cm²) を照射し、同様に引張弾性 率を測定したところ、1、500Kg/cm² であつた。

【0036】つぎに、0、2μm以上の大きさの異物が 0個である5インチシリコンウエハ(回路パターンのな いミラーウエハ)を所定の工程(イオン打ち込み処理工 程) に通して異物を付着させ、レーザ─表面検査装置 「自立電子エンジニアリング(株)製のLS-500 0] を用い、ミラ一面に付着した0, 2μ m以上の大き さの異物の数をカウントした。なお、ウエハの表裏に付 着する異物をカウントするため、ミラー面を表裏逆にし 40 た2通りの場合について同様の検査を行つた。

【0037】異物洗浄試験として、上記のように異物を 付着させたシリコンウエハのミラ─面に、前記の方法で 作製した粘着テープを、ハンドローラを用いて貼り付 け、3分間放置した。その後、粘着テープの背面側から 紫外線(波長365mm、1.000m] / cm () を照 射したのち、粘着テ─ブを剥離操作して、洗浄した。こ の洗浄後、再びレーザー表面検査装置を用いて、ミラー 面に付着している 0. 2 μ m以上の大きさの異物の数を カウントした。この貼り付けおよび剥離操作による洗浄 50

後の異物数と、洗浄前の異物数とから、シリコンウエハ の表基両面側の異物除去率をそれぞれ算出した。

【0038】これとは別に、粘治剤による汚染試験とし て、0.2μm以上の大きさの異物が0個である5イン チシリコンウエハ (回路パターンのないミラーウエハ) のミラ─面に、前記の方法で作製した粘着テ─プを、ハ ンドローラを用いて貼り付け、3分間放置した。その 後、粘着テープの背面側から紫外線(波長365nm、 1,000m J / cm") を照射したのち、粘着テープを 剥離操作した。この操作後、レーザー表面検査装置を用 いて、ミラ―面に付着している 0. 2 μ m以上の大きさ の異物の数をカウントし、粘着剤の付着による汚染状況 を調べた。

【0039】なお、上記の界物洗浄試験(異物除去率の 測定)および粘着剤汚染試験(付着異物数の測定)に際 し、一連の作業は、クラス10のクリーンルーム内(温 度23℃、湿度60%)で行つた。これらの試験結果 は、後記の表1に示されるとおりであつた。

【0040】実施例2

重合性オリゴマ─として粘度が1,200センチポイズ (25℃) のジトリメチロールプロパンテトラアクリレ ―ト120部を用いた以外は、実施例1と同様にしてア クリル系粘着剤の溶液を調製し、これを用いて実施例 1 と同様にして厚さ20μmの粘着剤圏を有する粘着テー プを作製した。

【0041】この粘着テープのシリコンウエハ(ミラー 面) に対する粘着力は、JIS Z-0237に準じて 測定される180度引き剝がし粘着力(常温、剥離速度 300mm/分)で750g/20mm幅であつた。また、 粘着テープの背面側から、活性エネルギー源として、紫 外線(波長365nm、1,000mJ/cm²)を照射 し、同様に粘着力を測定したところ、9g/20m幅で あつた。

【0042】また、実施例1と同様に引張弾性率測定用 の試料片を作製して、粘着剤層のみの引張弾性率を、JI SK 7127に準じて測定したところ、58Kg/cm であつ た。また、この粘着剤層に、紫外線(波長365nm、 1,000mJ/cm)を照射し、同様に引張弾性率を 測定したところ、1,860Kg/cm² であつた。

【0043】この粘着テープを用い、実施例1と同様に して、異物洗浄試験(異物除去率の測定)および粘着剤 汚染試験(付着異物数の測定)を行つた。これらの試験 結果は、後記の表1に示されるとおりであつた。

【0044】実施例3

重合性オリゴマーとして粘度が27、000センチポイ ズ(25℃)のウレタンアクリレート120部を用いた 以外は、実施例1と同様にしてアクリル系粘着剤の溶液 を調製し、これを用いて実施例1と同様にして厚さ20 μmの粘着剤層を有する粘着テープを作製した。

【0045】この粘着テープのシリコンウエハ(ミラー

(6)

特別平8-139067

10

【0046】また、実施例1と同様に引張弾性率測定用の試料片を作製して、粘着剤層のみの引張弾性率を、JISK7127に準じて測定したところ、84Kg/cm²であつ 10た。また、この粘着剤層に、紫外線(波長365nm、1,000mJ/cm²)を照射し、同様に引張弾性率を測定したところ、1,185Kg/cm²であつた。

【0047】この粘着テ一プを用い、実施例1と同様にして、異物洗浄試験(異物除去率の測定)および粘着剤汚染試験(付着異物数の測定)を行つた。これらの試験結果は、後記の表1に示されるとおりであつた。

【0048】比較例1

重合性オリゴマ―として粘度が750センチポイズ(2 5℃)のプロピオン酸ジペンタエリスリト―ルアクリレ 20 一ト120部を用いた以外は、実施例1と同様にしてア クリル系粘着剤の溶液を調製し、これを用いて実施例1 と同様にして厚さ20μmの粘着剤層を有する粘着テ― プを作製した。

【0049】この粘着テープのシリコンウエハ(ミラー面)に対する粘着力は、JIS Z-0237に準じて測定される180度引き剥がし粘着力(常温、剥離速度300mm/分)で160g/20mm幅であつた。また、粘着テープの背面側から、活性エネルギー源として、紫外線(波長365nm、1,000mJ/cm²)を照射30し、同様に粘着力を測定したところ、8g/20mm幅であつた。

【0050】また、実施例1と同様に引張弾性率測定用の試料片を作製して、粘着剤層のみの引張弾性率を、JISK7127に準じて測定したところ、50Kg/cm²であった。また、この粘着剤層に、紫外線(波長365nm、1,000mJ/cm²)を照射し、同様に引張弾性率を測定したところ、1,900Kg/cm²であつた。

【0051】この粘着テ一プを用い、実施例1と同様にして、从物洗浄試験(从物除去率の測定)および粘着剤 40 汚染試験(付着異物数の測定)を行った。これらの試験 結果は、後記の表2に示されるとおりであった。

【0052】比較例2

重合性オリゴマーとして粘度が750センチポイズ(2 5℃)のプロピオン酸ジペンタエリスリト―ルアクリレート40部を用いた以外は、実施例1と同様にしてアクリル系粘着剤の溶液を調製し、これを用いて実施例1と 同様にして厚さ 2 0 μ mの粘着剤層を有する粘着テープを作製した。

【0053】この粘着テープのシリコンウエハ(ミラー 面)に対する粘着力は、JIS Z-0237に準じて 測定される180度引き剥がし粘着力(常温、剥離速度 300mm/分)で500g/20mm幅であつた。また、 粘着テープの背面側から、活性エネルギー源として、紫外線(波長365nm、1,000mJ/cm²)を照射し、同様に粘着力を測定したところ、360g/20mm 幅であつた。

【0054】また、実施例1と同様に引張弾性率測定用の試料片を作製して、粘着剤層のみの引張弾性率を、JISK7127に準じて測定したところ、220Kg/cm²であつた。また、この粘着剤層に、紫外線(波長365 nm、1,000mJ/cm²)を照射し、同様に引張弾性率を測定したところ、465Kg/cm²であつた。

【0055】この粘着テ一プを用い、実施例1と同様にして、異物洗浄試験(異物除去率の測定)および粘着剤汚染試験(付着異物数の測定)を行った。これらの試験結果は、後記の表2に示されるとおりであった。

【0056】比較例3

重合性オリゴマーとして粘度が36,000センチポイズ(25 $^{\circ}$)のウレタンアクリレート120部を用いた以外は、実施例1と同様にしてアクリル系粘剤剤の溶液を調製し、これを用いて実施例1と同様にして厚さ20 $^{\circ}$ μ $^{\circ}$ πの粘着剤層を有する粘着テープを作製した。

【0057】この粘着テープのシリコンウエハ(ミラー面)に対する粘着力は、JIS Z-0237に準じて測定される180度引き剥がし粘着力(常温、剥離速度300mm/分)で1、450g/20mm幅であつた。また、粘着テープの背面側から、活性エネルギー源として、紫外線(波長365nm、1、000mJ/cm²)を照射し、同様に粘着力を測定したところ、120g/20mm幅であつた。

【0058】また、実施例1と同様に引張弾性率測定用の試料片を作製して、粘着剤層のみの引張弾性率、JIS K 7127に準じてを測定したところ、90 Kg/cm²であった。また、この粘着剤層に、紫外線(波長365 nm、1,000 m J/cm²)を照射し、同様に引張弾性率を測定したところ、450 Kg/cm²であった。

【0059】この粘着テ一プを用い、実施例1と間様にして、異物洗浄試験(異物除去率の測定)および粘着剤 汚染試験(付着異物数の測定)を行つた。これらの試験 結果は、後記の表2に示されるとおりであつた。

[0060]

【表1】

(7)

特開平8-139067

12

11

表1

	ウエハ の表裏	異物洗浄試験			粘溶剂污染試験
		異物数	(個)	- 異物除去率 (%)	付着異物數 (個)
		洗浄前	光净後		
実施例1	表面	299	29	90.3	6
	- 英田	6,604	600	90. 9	
尖施例 2	表面	267	3 2	88. 0	5
	上上	6,741	722	89. 3	
炭施例3		277	47	83. 0	7
	裏面	6, 432	965	85. 0	- 7

[0061]

* *【表2】 安 2

	ウエハの表裏	異物洗浴試験			粘着剃汚染試験
		巫物数	(個)	H 44-24-4-4-	/- 1
		洗浄前	洗浄後	異物除去率 (%)	付着異物数 (個)
比較例1	表面	302	測定不能	测定不能	31114de 72°040
	基面	6, 011	測定不能	測定不能	測定不能
比較例2	表面	254	144	43.3	14
	真面	7, 242	4, 073	43.8	14
比較例3	表面	275	163	40.7	16
	基面	7, 105	4, 156	41.5	

【0062】上記の表1、表2の結果から明らかなよう に、本発明の実施例1~3の粘着テープによれば、粘着 剤によるウエハ汚染の問題を生じることなく、シリコン ウエハの表面や裏面に付着した異物を90%前後までも の高い除去率で除去できるものであることがわかる。ま た、上記試験における剥離操作時の作業性も良好で、剥 離操作時にウエハを損傷させる心配もなかつた。

【0063】これに対し、低粘度の重合性オリゴマーを 用いた比較例1の粘潜テープでは、粘溶剤層の凝集力が 50 【0064】なお、上記の実施例1~3および比較例2

不足し、剥離時に粘着剤層が破壊して著しい糊残りを生 じ、異物除去率の測定ができなかつた。また、上記低粘 皮の重合性オリゴマ―の使用量を少なくした比較例2の 粘岩テ─プでは、粘着剤層の凝集力不足は起こさなかつ たが、活性エネルギー源による硬化が不十分で、異物除 去率が低かつた。また、高粘度の重合性オリゴマーを用 いた比較例3の粘着テープでは、活性エネルギー源によ る硬化がやはり不十分で、異物除去率が低かつた。

(8)

特期平8-139067

14

13

で示した洗浄方法を、所定の半薄体ウエハの製造工程に 適用し、最終的に得られた半導体デバイスの歩留りを集 計した結果、実施例1~実施例3の方法では、比較例2 の方法と比較して、歩留りが12%から18%も高くな ることがわかつた。

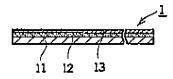
【図面の簡単な説明】

【図2】本発明の異物除去方法の一例を示す断面図である。 *10

* 【符号の説明】

- 1 粘着テ―ブ
- 11 支持フイルム
- 12 粘着剂層
- 13 セパレータ
- 2 シリコンウエハ
- 2 a シリコンウエハの表面
- 2 b シリコンウエハの裏面
- 3 シリコンウエハに付着した異物

[図1]

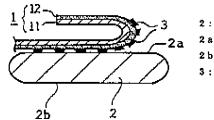


I: 粘着テープ 11: 支持フイルム

12:指着刺腾

13:サバレータ

【図2】



2:シリコンウエハ

26:ウエハ裏面

3:兵物